

Title (en)  
Plasma spraying installation

Title (de)  
Anordnung für eine Plasmaspritzanlage

Title (fr)  
Installation de projection à plasma

Publication  
**EP 1013791 A1 20000628 (DE)**

Application  
**EP 99810973 A 19991027**

Priority  
CH 256898 A 19981224

Abstract (en)  
A plasma spraying unit deflection system (5), comprising baffles (7, 8) within the spray chamber (1), is new. An Independent claim is also included for a plasma spraying unit provided with the above deflection system.

Abstract (de)  
Es wird eine Anordnung für eine mit einer Behandlungskammer (1) und einem darin angeordneten Plasmaspritzgerät (2) versehene Plasmaspritzanlage vorgeschlagen. Um zu verhindern, dass in der Behandlungskammer (1) eine Gasströmung entsteht, welche Ablagerungen aufwirbelt, ist eine zumindest teilweise im Innenraum der Behandlungskammer (1) angeordnete Ablenkeinrichtung (5) vorgesehen. Vertikal unterhalb der Behandlungskammer (1) ist ein Sammelerschacht (6) angeordnet. Im Übergangsbereich von der Behandlungskammer (1) zum Sammelerschacht (6) ist ein mit Ablenkelementen (31) versehenes Grundelement (7) angeordnet, welches zumindest eine Durchlassöffnung (4) zwischen der Behandlungskammer (1) und dem Sammelerschacht (6) freilässt. Im Sammelerschacht (6) ist ein im wesentlichen kegelförmig ausgebildetes, in die Durchlassöffnung (4) des Grundelements (7) ragendes Ablenkelement (8) vorgesehen. Der Sammelerschacht (6) steht zudem mit der Saugseite eines Gebläses (13) und einer Vakuumpumpe (12) in Verbindung. <IMAGE>

IPC 1-7  
**C23C 4/12**

IPC 8 full level  
**C23C 4/00** (2006.01); **C23C 4/12** (2006.01); **C23C 4/134** (2016.01); **C23C 4/137** (2016.01)

CPC (source: EP US)  
**C23C 4/134** (2016.01 - EP US); **C23C 4/137** (2016.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] GB 815804 A 19590701 - PLESSEY CO LTD
- [A] DE 3740498 A1 19890608 - MATTHAEUS HEINZ DIETER [DE]
- [A] US 3100724 A 19630813 - ROCHEVILLE CHARLES F
- [A] DE 3704551 C1 19880511 - GEMA RANSBURG AG
- [A] DE 1962698 A1 19710624 - BUETTNER SCHILDE HAAS AG
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 597 (C - 1127) 2 November 1993 (1993-11-02)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 012 26 December 1996 (1996-12-26)
- [A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 012 26 December 1996 (1996-12-26)

Cited by  
EP3112495A1

Designated contracting state (EPC)  
DE FR GB IT NL

DOCDB simple family (publication)  
**EP 1013791 A1 20000628**; **EP 1013791 B1 20050810**; CA 2289870 A1 20000624; CA 2289870 C 20050705; CH 697092 A5 20080430; DE 59912388 D1 20050915; JP 2000239822 A 20000905; JP 4637309 B2 20110223; SG 85147 A1 20011219; US 6357386 B1 20020319

DOCDB simple family (application)  
**EP 99810973 A 19991027**; CA 2289870 A 19991117; CH 256898 A 19981224; DE 59912388 T 19991027; JP 36587099 A 19991224; SG 1999005453 A 19991103; US 44920699 A 19991124